

Study on Photocatalytic and Sonocatalytic Activity of Bi₂O₃ Synthesized by Sol-gel Method in Removing Organic Compounds of Ardabil Textile Factory Effluents

P. Nouri Dodaran¹, E. Fataei², B. Khanizadeh³

1. MSc Student of Environmental Pollutants, Dept. of Environmental Engineering,
Faculty of Science, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2. Assoc. Prof., Dept. of Environmental Engineering, Faculty of Science,
Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

(Corresponding Author) ebfataei@gmail.com
3. Assist. Prof., Dept. of Chemistry, Faculty of Science,
Sarah Branch, Islamic Azad University, Sarah, Iran

(Received Sep. 15, 2018 Accepted Jan. 27, 2019)

To cite this article :

Nouri Dodaran, P., Fataei, E., Khanizadeh , B., 2019, "Study on photocatalytic and sonocatalytic activity of Bi₂O₃ synthesized by Sol-gel method in removing organic compounds of ardabil textile factory effluents." Journal of Water and Wastewater, 30(4), 67-77. Doi: 10.22093/wwj.2018.110808.2566. (In Persian)

Abstract

Dye content of the textile industry wastewater has either chemical structure resistant against the purification processes such as physical, chemical and biological treatment methods or low removal efficiency. Thus, alternative methods must be used in order to remove the organic compounds of these effluents. In the present study we used bismuth oxide nanoparticles to remove the organic compounds from effluents of Ardabil Textile Factory. in the present study in order to use nanoparticle technology to remove organic compounds, firstly sol-gel method was used to synthesize the bismuth oxide nanoparticles, which were examined using XRD, FESEM and DRS techniques. Then, the nanoparticles were examined for their sonocatalytic and photocatalytic activities in the process of removing the organic compounds from the effluents of Ardabil Textile Factory. Results showed that compounds such as n-Decane, n-Dodecane, n-tetradecane and Hexadecane accounted for up to 70% of the abundance of chemical compounds. In the nanoparticle-free sample subject to ultrasonic waves, the removal rate of the chemical compounds including n-Decane, n-Dodecane, n-Tetradecane and Hexadecane was as low as 2.86%, 6.25%, 8.33% and 25%, respectively. In contrast, in the sample containing nanoparticles subject to ultrasonic waves the removal rate for n-Decane and n-Dodecane was as high as 92.14% and 95.13%, respectively, for n-Tetradecane and Hexadecane was over 99%. In the sample subject to UV and in the presence of bismuth oxide nanoparticles, n-Decane and n-Dodecane was removed by 92.82% and 93.75%, respectively, whereas n-Tetradecane and Hexadecane was removed by over 99%. results revealed that US without nanoparticles had a little efficiency in removing the organic compounds. Whereas, both the US/Bi₂O₃ and UV/Bi₂O₃ processes had a removal efficiency of over 90%. Thus, adding nanoparticles of Bi₂O₃ to the effluents can make a substantial contribution to the removal of organic compounds from the textile industry effluents.

Keywords: Wastewater Treatment, Textile Wastewater, Photocatalyst, Sonocatalyst, Bi₂O₃, Sol-gel Method.



بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل

پریسا نوری دودران^۱، ابراهیم فتائی^۲، بهنام خانیزاده^۳

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آلودگی‌های محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
- ۲- دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) ebfataei@gmail.com
- ۳- استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

(دریافت ۹۷/۷۲۴ پذیرش ۹۷/۱۱/۷)

برای ارجاع به این مقاله به صورت زیر اقدام بفرمایید:

نوری دودران، پ.، فتائی، ا.، خانیزاده، ب.، ۱۳۹۸، "بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل" مجله آب و فاضلاب، ۳۰(۴)، ۶۷-۷۷.
Doi: 10.22093/wwj.2019.110808.2566

چکیده

ساختر شیمیایی مواد رنگزای موجود در پساب صنایع نساجی در برابر فرایندهای تصفیه مرسوم شامل روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مقاوم هستند، راندمان حذف آنها کم است و تولید پساب ثانویه می‌کنند، بنابراین باید از روش‌های پیشرفته دیگری برای حذف ترکیبات آلی این گونه پساب‌ها استفاده شود. در این پژوهش از نانوذرات بیسموت اکسید برای حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل استفاده شد. ابتدا نانوذرات بیسموت اکسید به روش سل-ژل سنتز شد و با روش‌های FESEM-XRD و DRS مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت سونوکاتالیستی و فتوکاتالیستی این ذرات در حذف ترکیبات به ترتیب به محدودیت DRS محدود نشد. نتایج نشان داد که حدود ۷۰ درصد فراوانی ترکیبات شیمیایی، مربوط به ترکیبات کارخانه نساجی اردبیل بررسی شد. در نمونه تحت تأثیر امواج التراسونیک بدون نانوذرات Hexadecane، n-Tetradecane، n-Decane و n-Dodecane نیز بیشتر از ۲۵٪ تأثیر امواج التراسونیک داشت. در نمونه تحت تأثیر امواج n-Tetradecane، n-Decane و n-Dodecane نیز بیشتر از ۲۵٪ تأثیر امواج التراسونیک داشت. در نمونه تحت تأثیر امواج n-Dodecane و n-Decane نیز بیشتر از ۲۵٪ تأثیر امواج التراسونیک داشت. در نمونه تحت تأثیر امواج UV در حضور نانوذره بیسموت اکسید، ترکیبات شیمیایی n-Tetradecane، n-Decane و n-Dodecane به ترتیب به مقدار ۹۵/۱۳٪، ۹۲/۱۴٪ درصد و ترکیبات شیمیایی n-Decane، n-Tetradecane و n-Dodecane به ترتیب به میزان ۹۹٪ درصد حذف شد. در نمونه تحت تأثیر امواج UV در حضور نانوذره بیسموت اکسید، ترکیبات شیمیایی n-Decane، n-Tetradecane و n-Dodecane به ترتیب به میزان ۹۲/۸۲٪، ۹۳/۷۵٪ درصد حذف و ترکیبات شیمیایی n-Decane، n-Tetradecane و n-Dodecane به ترتیب به میزان ۹۹٪ درصد حذف شدند. نتایج مشخص نمود که فرایند US بدون حضور نانوذره، کارایی اندکی در حذف ترکیبات آلی دارد. در صورتی که هر دو فرایند US/Bi₂O₃ و UV/Bi₂O₃ دارای راندمان حذف بیش از ۹۰ درصد هستند. بنابراین طبق نتایج، افزودن نانوذره Bi₂O₃ به محلول فاضلاب می‌تواند نقش بسزایی در حذف ترکیبات آلی فاضلاب داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: تصفیه فاضلاب، پساب نساجی، فتوکاتالیست، سونوکاتالیست، اکسید بیسموت، روش سل-ژل

۱- مقدمه

تصفیه فاضلاب این صنایع انجام گیرد (Seyed Mousavi and

Saeb, 2019)

لذا در سال‌های اخیر پژوهشگران روش‌های مختلفی را برای تجزیه مولکول‌های پیچیده و مقاوم به مولکول‌های ساده‌تر موردن

فضایل این صنایع نساجی به دلیل ترکیبات رنگی موجود در آن، دارای پیچیدگی‌های خاصی در فرایند تصفیه است (Grčić et al., 2013).

بنابراین قبل از تخلیه این نوع فاضلاب به آب‌های پذیرنده و رودخانه‌ها و تخلیه به چاهه‌ای عمیق، لازم است فرایندهایی برای



کارخانجات می شود، لذا تخریب این آلاینده‌ها برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب ضروری است. در پژوهش حاضر به منظور استفاده از فناوری نانوذرات در حذف ترکیبات آلی، ابتدا نانوذرات بیسوموت اکسید سنتز شد. خصوصیات ساختاری DRS، FESEM، XRD و شناسایی شد و پسیس فعالیت سونوکاتالیزوری و فتوکاتالیزوری این ذرات در حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

۲- مواد و روش‌ها

این پژوهش یک پژوهش تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد.

۱-۱- مواد

نیترات بیسوموت ۵ آبه به عنوان منبع بیسوموت، اسید نیتریک، اسید سیتریک، اتانول و پلی اتیلن گلیکول محصول شرکت مرک^۱ مورد استفاده قرار گرفت. پسیس خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب برای شناسایی و حذف آلاینده‌ها از کارخانه نساجی اردبیل تأمین شد. در کل آزمایش‌ها از آب مقطر دیونیزه استفاده شد.

۲-۲- سنتز نانوذرات بیسوموت اکسید با استفاده از روش سل-ژل

نانوذرات Bi_2O_3 به روش سل-ژل سنتز شد. طبق محاسبات استوکیومتری ابتدا $4/485$ گرم از نیترات بیسوموت ۵ آبه در $4/2$ میلی لیتر محلول اسید نیتریک غلیظ با نسبت اسید به آب ($1:8$) حل شد. سپس ۲ گرم اسید سیتریک به آرامی به محلول اضافه و زمان داده شد تا محلول شفافی حاصل شود. در پایان $2/6$ گرم سورفتکتانت پلی اتیلن گلیکول سنتز شد. در دستورالعمل اضافه شد. در تمامی مراحل، محلول روی همزن مغناطیسی با سرعت 300 دور در دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داشت. در نهایت پس از بهم خوردن به مدت 3 ساعت، محلول ایجاد شده برای واکنش‌های تکمیلی در بوته چینی ریخته شد و در دمای 120 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت در آون قرار داده شد تا تغییر محلولی به صورت کامل انجام شود. در ادامه ماده به دست آمده برای خالص‌سازی

بررسی قرار داده‌اند که یکی از نتایج این پژوهش‌ها، معرفی روش‌های جدید تحت عنوان فرایندهای اکسیداسیون پیشرفت‌ه است (Lee et al., 2001). فرایندهای اکسیداسیون پیشرفت‌ه بر پایه تشکیل رادیکال‌های فعالی نظری رادیکال‌های هیدروکسیل و سوپر اکسید قرار دارند. این فرایندها می‌توانند به منظور تصفیه کامل پسیس و تبدیل کلیه آلاینده‌ها به دی اکسید کردن، آب و نمک‌های معدنی غیر مضر به کار گرفته شوند.

در سال‌های اخیر فناوری سل-ژل به عنوان یک روش کارآمد، ساده و با صرفه اقتصادی برای سنتز نانوذرات در دمای پایین مورد توجه قرار گرفته است. روش سل-ژل یک روش شیمیایی است که در آن یک پیش‌ساز با ساختار nM(OR) به یک شبکه معدنی حاوی اکسید فلز متصل می‌شود (Gaya and Abdullah, 2008).

در این فرایند، پلیمریزه شدن معدنی اتفاق می‌افتد به این ترتیب که در اثر واکنش آکتوکسید در مجاورت آب، مایع (محلول) به یک شبکه ژل مانند و در نهایت به یک جامد تبدیل می‌شود و فراورده نهایی آن، شبکه اکسیدی حاوی خوش‌های اکسید فلزی M-O-M است (Grieve and Mulvaney, 2005).

یکی از روش‌های اکسیداسیون پیشرفت‌ه، واکنش‌های فتوکاتالیستی است. واکنش‌های فتوکاتالیستی از طریق تابش نوری با انرژی کافی در محدوده UV و Vis به یک نیم رساناً انجام می‌شود که باعث برانگیخته شدن الکترون‌های نوار ظرفیت و انتقال آنها به نوار رسانش می‌شود. الکترون برانگیخته شده می‌تواند مولکول‌های آلاینده را احیا کند یا با الکترون گیرنده‌هایی نظری O_2^- جذب شده روی سطح کاتالیست یا حل شده در آب واکنش داده، آنیون رادیکالی سوپر اکسید تولید کند. حفره ایجاد شده نیز می‌تواند مستقیماً مولکول‌های آلاینده را اکسید کرده یا با H_2O یا OH^- واکنش داده و آنها را به رادیکال هیدروکسیل (OH^{*}) تبدیل کند (Mousavi et al., 2013).

آنجو و همکاران در سال ۲۰۱۲ تخریب آلاینده فنل در آب را در حضور کاتالیست‌های ZnO و TiO_2 تحت UV و US و ترکیبی از دو روش (UV+US) انجام دادند. نتایج نشان داد که ZnO نسبت به TiO_2 در فرایند سونو-فتوکاتالیتیکی (UV+US) در تخریب فنل بیشتر فعال است (Anju et al., 2012).

با توجه به اینکه در فرایند تولید صنایع نساجی، ترکیبات مختلفی از آلاینده‌های آلی خطی و حلقوی وارد پسیس این

¹ Merck

گرفته، انجام شد. در طول آزمایش اکسیژن از ته لوله کوارتز وارد محلول می‌شد. منبع تابش UV-C (Osram, HNS, 15W, $\lambda_{\text{max}}=254\text{nm}$) بود.

برای تخریب فتوکاتالیستی، ۱/۰ گرم نانوذره Bi_2O_3 به محلول پساب اضافه شد. برای ایجاد محلول سوپاپتاسیون، محلول حاوی نانوذره به مدت ۱۵ دقیقه در حمام التراسونیک قرار داده شد. سپس تحت تابش اشعه UV در مدت زمان یک ساعت نمونه‌داری انجام شد و پس از سانتریفیوژ و خارج کردن نانوذرات برای انجام شناسایی با GC-MS در محیط سرد نگهداری شد. سانتریفیوژ تمامی مراحل فوق با ۱۰۰۰ دور در دقیقه و در مدت زمان ۲۰ دقیقه انجام شد.

پیش از تزریق نمونه به GC-MS از استخراج مایع-مایع با استفاده از قیف دکانتور و حلال آلی هگزان نرمال استفاده شد و فاز آلی پس از استخراج در حجم مشخص به دستگاه GC-MS (Agilent 7890A) منتقل و شناسایی انجام شد.

۳-۲- شناسایی نانوذرات

فاز کریستالی و اندازه کریستالی متوسط نانوذره سنتز شده با استفاده از روش XRD (مدل X-ray diffractometer JDX8030) شناسایی شد. الگوی XRD با استفاده از منبع تابش Cu $\text{k}\alpha$ با طول موج ۱۵۴/۰ نانومتر در ۴۰ کیلوولت و ۱۰۰ میلی آمپر در محدوده پراکنش (۲۰) ۱۰ تا ۸۰ درجه به دست آمد. اندازه متوسط کریستال با استفاده از معادله شر^۱ محاسبه شد.

روش FESEM ساختار، مورفولوژی اندازه و شکل نانوذرات را مشخص می‌کند (Gopalkrishna et al., 2013). در این پژوهش مورفولوژی و اندازه ذره با استفاده از MIRA3-TE FESEM (مدل Co SCAN DRS, UV-Vis diffuse reflectance spectrophotometer) با استفاده از اسپکتروسکوپی UV-2550, Shimadzu, Japan به دست آمد. نتایج DRS با استفاده از معادله کیوبلکا^۲ به منحنی مربوطه تبدیل شد. انرژی باند گپ از طریق معادله کیوبلکا مانک^۳ حاصل شد و مقدار باند گپ (E_g) با استفاده از منحنی F(R).hv^{0.5} در مقابل انرژی (hv) و

بیشتر با آب مقطر و اتانول شسته شد. سپس به منظور خشک شدن به مدت نیم ساعت در دمای ۱۸۰ درجه سلسیوس در آون قرار داده شد تا پودر قهوه‌ای رنگ به دست آید. پس از آن برای ایجاد نانوپودر و به دست آوردن تخلخل‌های لازم، عملیات کلسینه شدن در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس به مدت یک ساعت در داخل کوره انجام شد. با طی شدن زمان کلسینه شدن، پودر به دست آمده به آرامی در داخل دسیکاتور سرد شد و با هاون به آرامی پودر شد و به این ترتیب نانوذرات Bi_2O_3 سنتز شدند.

۳-۳- آزمایش فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی

نمونه واقعی پساب از تصفیه خانه فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل از محل خروجی تصفیه خانه فاضلاب قبل از اتصال به شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی ۲ اردبیل برداشت شد و در دمای ۵ درجه سلسیوس به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور بررسی اثر سیستم‌های UV/ Bi_2O_3 , US/ Bi_2O_3 , US/Bi₂O₃ بر روی پساب کارخانه نساجی اردبیل آزمایش‌ها به شرح زیر انجام شد:

(الف) به منظور بررسی اثر امواج التراسونیک در حذف ترکیبات آلی فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل، مقدار ۱۰۰ سی سی از پساب، داخل ارلن مایر ریخته شد. سپس ارلن محتوى فاضلاب در داخل حمام التراسونیک (Sonica-2200ETH, Italy, 260W, 40 kHz) در ابعاد ۲۴×۱۴×۱۰ سانتی‌متری در محل ثابت قرار داده شد و پس از گذشت یک ساعت تابش امواج ماورای صوت، نمونه از حمام خارج شد. پس از سانتریفیوژ، نمونه برای استخراج و شناسایی با دستگاه GC-MS در محیط سرد نگهداری شد.

(ب) به منظور بررسی اثر همزمان نانوذرات Bi_2O_3 و امواج التراسونیک، مقدار ۱۰۰ سی سی از پساب کارخانه نساجی داخل Bi₂O₃ ارلن مایر ریخته شد. سپس مقدار ۱/۰ گرم از نانوکاتالیست MIRAL3-TE به محلول اضافه و سوپاپتاسیون به دست آمده به کمک همزن مغناطیسی در ۵۰۰ دور در دقیقه هم زده شد. نمونه به حمام التراسونیک انتقال یافت و پس از گذشت یک ساعت تابش امواج US، از حمام خارج شد و مانند حالت الف، پس از سانتریفیوژ برای انجام شناسایی با GC-MS در محیط سرد نگهداری شد.

(ج) تمام آزمایش‌های فتوکاتالیستی در یک راکتور از جنس کوارتز به ابعاد ۳۵×۲/۵ سانتی‌متر که به طور موازی با لامپ UVC قرار

¹ Scherrer Equation

² Kubleka Equation

³ Kubleka-Munk Function

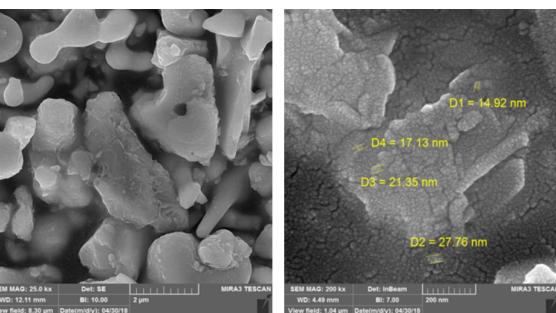


Fig. 2. SEM image of Bi_2O_3 nanoparticles calcinated in 600 °C

شکل ۲- تصویر SEM نانوذره اکسید بیسموت کلسینه شده در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس

برونیابی بخش خطی طیف با محور $h\nu$ به دست آمد
(Eskandarloo et al., 2016)

۳- نتایج و بحث

۱- مطالعه ساختاری XRD

الگوی XRD نانوذره در شکل ۱ آورده شده است. الگوی XRD نشان می‌دهد که هیچ گونه پیک ناخالصی وجود ندارد. مقدار ۲۰ برای پیک پراکنش در الگوی XRD نانوذره اکسید بیسموت در ۲۷/۷۷ درجه و مقدار بتا (β) یا FWHM برابر ۱۸/۰ درجه است.

اندازه متوسط نانوذرات Bi_2O_3 توسط معادله شرر (معادله ۱) ۴۶/۲ نانومتر به دست آمد.

$$D = \frac{0/9\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (1)$$

$$D = \frac{0/9 \times 0/154}{\frac{0/18 \times 3/1416}{180} \cos\left[\frac{27/722}{2}\right]} = 46/2 \text{ nm}$$

Bi_2O_3

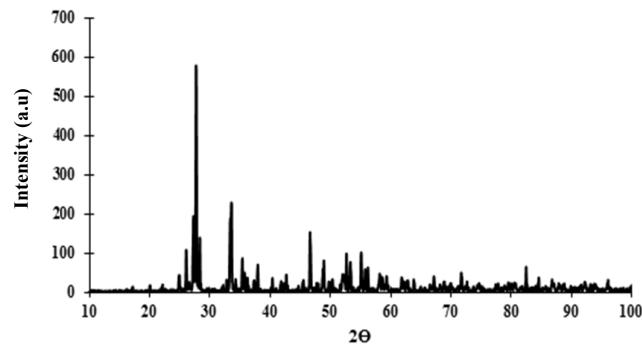


Fig. 1. XRD pattern of Bi_2O_3 nanoparticles calcinated in 600 °C

شکل ۱- الگوی XRD نانوذره اکسید بیسموت کلسینه شده در ۶۰۰ درجه سلسیوس

$$E_g = \frac{1239/8}{\lambda} \quad (2)$$

مقدار باند گپ بیسموت اکسید سنتز شده از مقدار واقعی، انحراف زیادی ندارد.

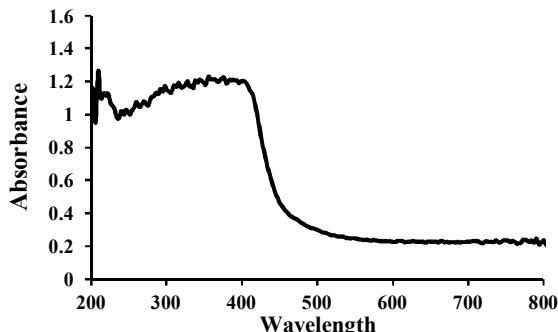


Fig. 3. DRS pattern of Bi_2O_3 nanoparticles calcinated in 600 °C

شکل ۳- طیف اسپکترومتری UV-Vis یا DRS نانوذره اکسید بیسموت کلسینه شده در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس

۴- بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید

نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل

۲- مطالعه FESEM

شکل ۲ تصویر FESEM و سطح مورفولوژی نانوذرات را نشان می‌دهد. تصویر نشان می‌دهد که نمونه دارای مورفولوژی کروی با توزیع غیر یکنواخت است که میانگین اندازه رگه برابر ۲۹/۲۰ نانومتر است.

آماده شده بود. فعالیت فتوکاتالیستی نمونه‌ها در حذف گونه‌های آلی موجود در فاضلاب با تابش اشعه UVC در جدول ۳ نشان داده است. فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات ارتباط مستقیم با باند گپ نانوذره نیم رسانا دارد. باند گپ بالا باعث فعالیت بالای فتوکاتالیستی می‌شود.

در اثر تابش، جفت الکترون - حفره تشکیل شده در سطح نانوذره، باعث می‌شود الکترون‌ها از باند ظرفیت به باند رسانش منتقل شده و حفره‌های تولید شده در باند ظرفیت باعث تولید گونه‌های فعال رادیکالی همچون رادیکال هیدرائکسید، سوپراکسید و ترکیب پراکسید هیدروژن در محلول ایجاد نمایند. این رادیکال‌ها و

و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در آن از طریق دستگاه GC-MS، در جدول ۱ نشان داده شده است. کروماتوگرام نمونه اولیه قبل از حذف ترکیبات آلی که از طریق دستگاه GC-MS اندازه‌گیری شده بود، در شکل ۵ ارائه شده است. کروماتوگرام نمونه اولیه نشان می‌دهد که از بین ترکیبات ذکر شده حدود ۷۰ درصد فراوانی ترکیبات آلی مربوط به ترکیبات n-Dodecane، n-Decane و Hexadecane است. به این منظور در ادامه فراوانی این ترکیبات قبل و بعد از حذف توسط روش‌های ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفت (جداوی ۲ و ۳).

Kubelka-Munk Function

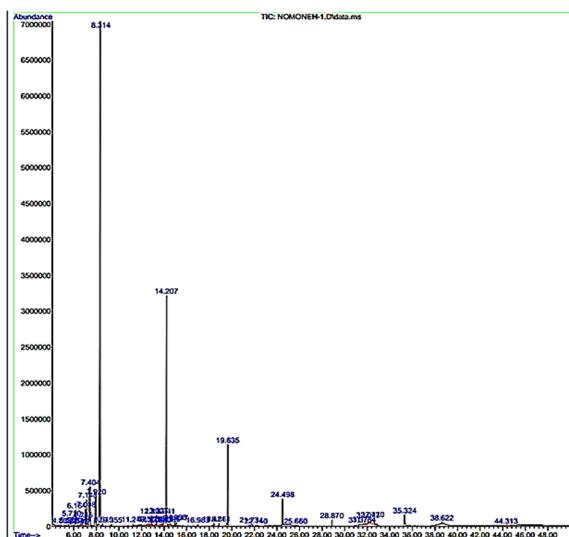


Fig. 5. GC-MS chromatogram of the initial sample before removing the organic compounds

شکل ۵- کروماتوگرام GC-MS نمونه اولیه قبل از حذف ترکیبات آلی

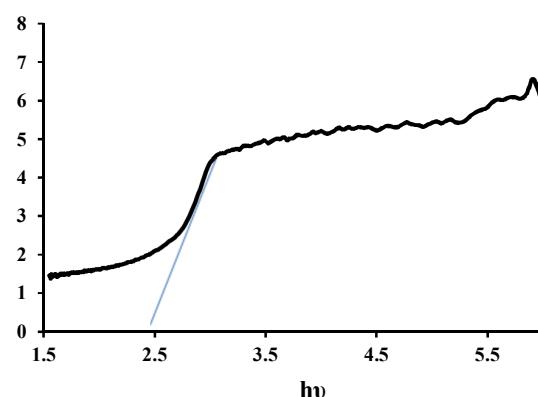


Fig. 4. Kubelka graph for determinate gap band of Bi_2O_3 nanoparticles calcinated in 600 °C

شکل ۴- نمودار کیوبلکا برای تعیین باند گپ نانوذره اکسید بیسموت کلسینه شده در دمای ۶۰۰ درجه سلسیوس

۱-۴-۳- تخریب فتوکاتالیستی

هدف اصلی از این پژوهش، آزمایش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذره

جدول ۱- ترکیبات آلی موجود در فاضلاب شناسایی شده توسط GC-MS

Table 1. Organic compounds identified in wastewater by GC-MS

Hexadecane	n-tetradecane	n-Dodecane	3-methyl-cyclopentane
Nonane	5-methyl-nonane	3-methyle-nonane	1-chloro-nonane
n-Decane	1-ethyl-3-methyl-cyclopentane	dimethyl-Hexane-2,4	1-Butene-3-ethoxy
	9,12-octadecadienoic acid	3-methyl Octane	1-hexyi-3-methyl-syclopentane

جدول ۲- درصد فراوانی ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در نمونه اولیه قبل از حذف

Table 2. Abundance of the organic compounds identified in the first sample before removal

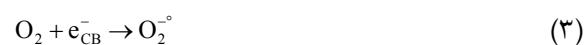
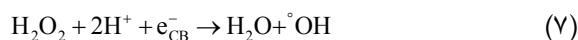
Row	Percentage frequency (%)	Chemical compounds	Structural formula
1	48.95	n-Decane	
2	16.18	n-Dodecane	
3	5.04	n-tetradecane	
4	1.79	Hexadecane	

جدول ۳- فراوانی ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در نمونه تحت تأثیر امواج UV با نانوذرات بیسموت اکسید (UV/Bi₂O₃)Table 3. Percentage frequency of chemical compounds of the wastewater sample exposed to ultraviolet with Bi₂O₃ nanopartical

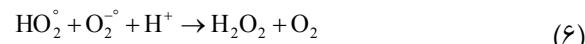
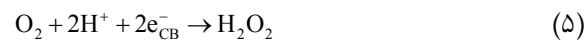
Row	Percentage frequency(%)	Chemical compounds	Structural formula
1	9.32	n-Decane	
2	3.06	n-Dodecane	
3	0.92	n-tetradecane	
4	-	Hexadecane	

همچنین پراکسید تولید شده در اثر واکنش به گونه‌های فعال هیدروکسیل تبدیل می‌شود

ترکیبات تولید شده بر اساس واکنش‌های زیر در حضور اکسیژن موجود منجر به تخریب گونه‌های آلی می‌شود



ترکیبات شیمیایی شناسایی شده از طریق دستگاه GC-MS در نمونه تحت تأثیر امواج UV با نانوذرات Bi₂O₃ در جدول ۴ ارائه شده است. طبق نتایج حاصل از کروماتوگرام دستگاه GC-MS (شکل ۶)، در نمونه تحت تأثیر امواج UV در حضور نانوذرات بیسموت اکسید، n-Decane و n-Dodecane به ترتیب به میزان ۹۳/۷۵ و ۹۲/۸۲ درصد و n-Tetradecane و n-Hexadecane نیز بیشتر از ۹۹ درصد و n-Decane به مقدار ۹۲/۸۲٪ حذف شدند.



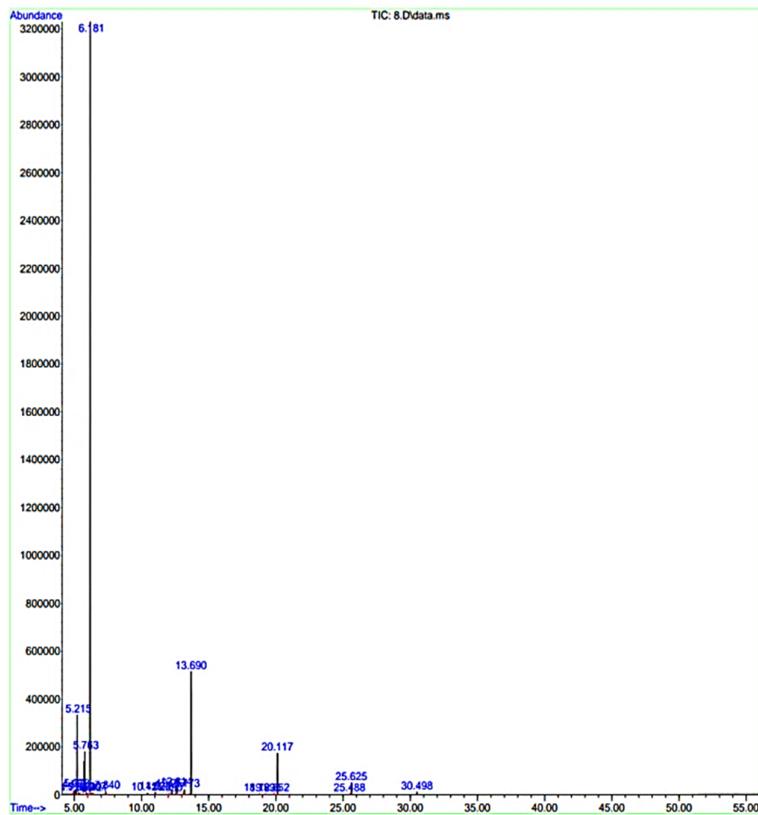


Fig. 6. GC-MS Chromatogram of the wastewater sample exposed to ultraviolet with Bi_2O_3 nanoparticle
شکل ۶- کروماتوگرام GC-MS نمونه پساب تحت تاثیر تابش UV

فشاری بالاتر از ۱۰۰۰ اتمسفر هستند که در نهایت با تشکیل رادیکال‌های OH^\bullet , HO_2^\bullet , H^\bullet و O^\bullet در اطراف جباب‌ها باعث اکسید آلاینده‌های آلی می‌شود (Eskandarloo et al., 2016). رادیکال‌های تولید شده، مشابه مکانیسم فتوکاتالیستی باعث تخریب گونه‌های آلی موجود در محیط واکنش می‌شوند.

ترکیباتی که در نمونه تحت تأثیر امواج التراسونیک از طریق دستگاه GC-MS شناسایی شدند، مطابق کروماتوگرام موجود در شکل ۷، در جدول ۵ ارائه شده‌اند. جدول ۶ نشان می‌دهد که در نمونه تحت تأثیر امواج التراسونیک بدون نانو ذره، ترکیبات شیمیایی n -Tetradecane, n -Dodecane, n -Decane به ترتیب به میزان ۲/۸۶, ۶/۲۵, ۸/۳۳ درصد حذف شده‌اند. ترکیبات شیمیایی شناسایی شده از طریق دستگاه GC-MS در نمونه تحت تأثیر امواج التراسونیک با نانوذره Bi_2O_3 در جدول ۷ ارائه شده است. طبق نتایج حاصل از

جدول ۴- درصد حذف فتوکاتالیستی مواد موجود در فاضلاب در حضور نانوذره اکسید بیسموت

Table 4. Photocatalytic removal percentage of chemical compounds in wastewater with Bi_2O_3 nanopartical

Chemical compound	Photocatalytic removal percentage (%)
n -Decane	92.82
n -Dodecane	93.75
n -Tetradecane	More than 99
n -Hexadecane	More than 99

۲-۴-۳- تخریب سونوکاتالیستی

مکانیسم اصلی امواج US در اکسیداسیون آلاینده‌ها، شامل ایجاد حفره یا میکرو جباب‌های بسیار ریزی است که به دنبال پدیده حفره‌سازی صوتی در آب شکل می‌گیرند. حفره‌های ایجاد شده در آب نقاطی موضعی به نام نقاط داغ با دمای ۵۰۰۰ درجه کلوین و

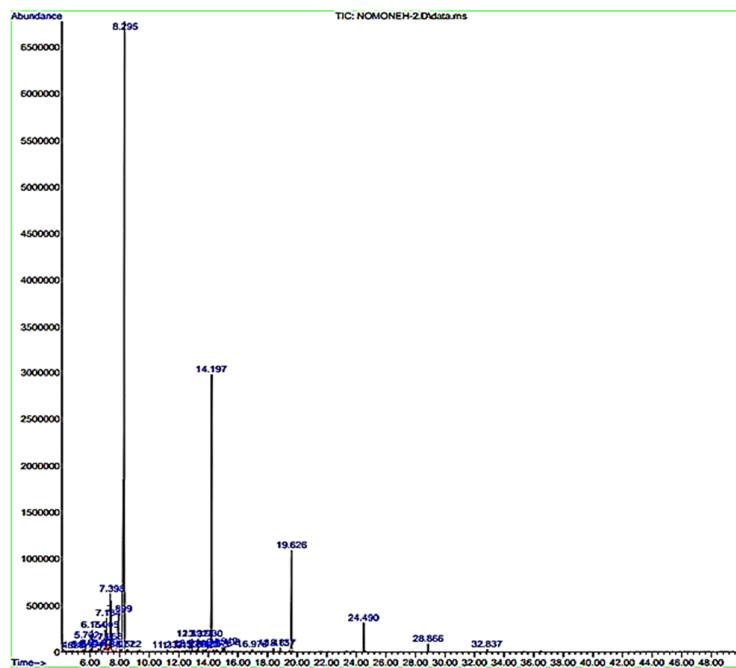


Fig. 7. GC-MS chromatogram of the wastewater sample exposed to ultrasound
شکل ۷- کروماتوگرام GC-MS نمونه پساب تحت تاثیر امواج التراسونیک

جدول ۵- درصد فراوانی ترکیبات شناسایی شده در نمونه تحت تاثیر امواج التراسونیک

Table 5. Abundance of the compounds identified in the sample subject to ultrasonic waves

Row	Percentage frequency (%)	Chemical compounds	Structural formula
1	53.11	n-Decane	
2	17.39	n-Dodecane	
3	5.66	n-tetradecane	
4	1.50	Hexadecane	

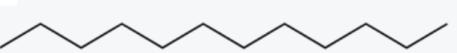
جدول ۶- درصد حذف سونوکاتالیستی مواد موجود در فاضلاب بدون حضور نانوذرات

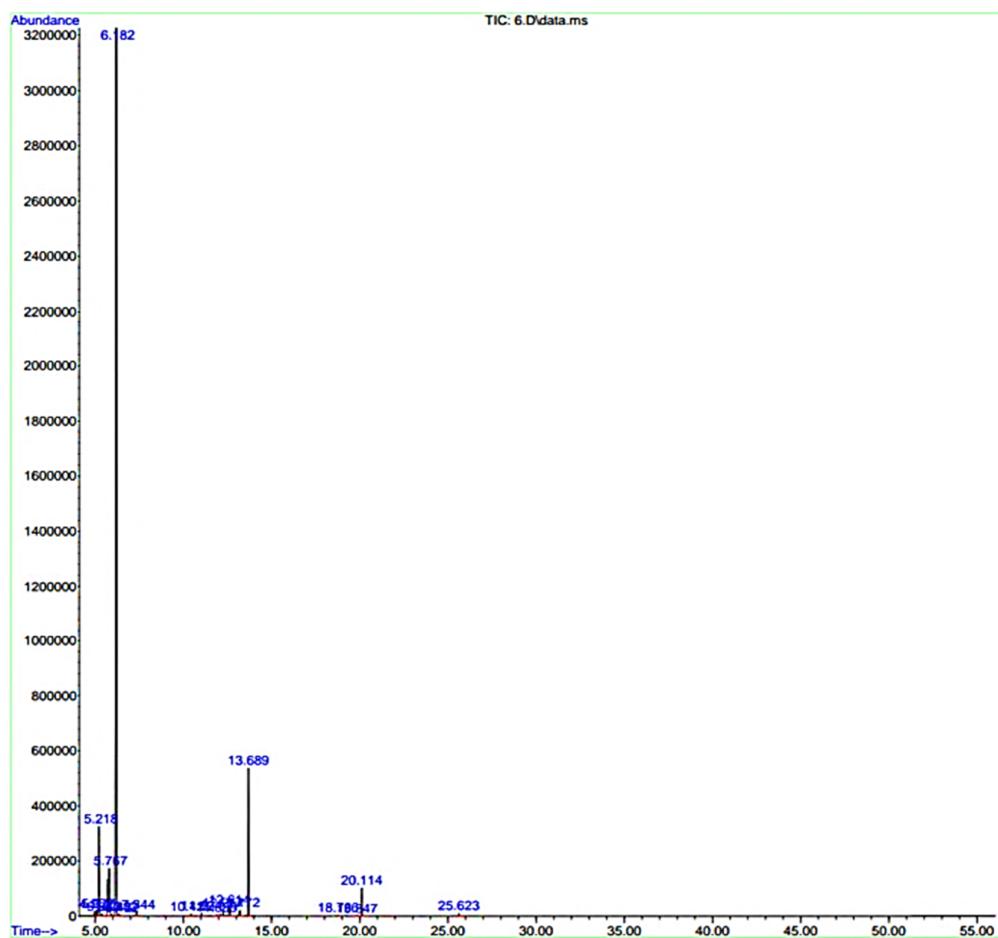
Table 6. Sonocatalytic removal percentage of chemical compounds in wastewater without nanoparticals

Chemical compounds	Removal percentage with ultrasound waves(%)
n-Decane	2.86
n-Dodecane	6.25
n-Tetradecane	8.33
Hexadecane	25



جدول ۷- فراوانی ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در نمونه تحت تاثیر امواج التراسونیک با نانو ذره (US/Bi₂O₃)**Table 7.** Percentage frequency of chemical compounds of the wastewater sample exposed to ultrasound with Bi₂O₃ nanoparticle

Row	Percentage frequency(%)	Chemical compounds	Structural formula
1	9.39	n-Decane	
2	1.75	n-Dodecane	
3	0.19	n-tetradecane	
4	-	Hexadecane	

**Fig. 8.** GC-MS chromatogram of the wastewater sample exposed to ultrasound with Bi₂O₃ nanoparticle
شکل ۸- کروماتوگرام GC-MS نمونه پساب تحت تاثیر امواج التراسونیک و نانوذرات Bi₂O₃

۴- نتیجه‌گیری

این پژوهش به منظور بررسی امکان سنتز نانوذرات بیسوموت اکسید به روش سل-ژل و بررسی فعالیت سونوکاتالیزوری و فتوکاتالیزوری این ذرات در حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب کارخانه نساجی اردبیل انجام گرفت.

نتایج نشان داد که هر دو فرایند $\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{US}$ و $\text{UV}/\text{Bi}_2\text{O}_3$ درای راندمان حذف بیش از ۹۰ درصد هستند. نتایج مشخص نمود که افزودن نانوذرات Bi_2O_3 به محلول فاضلاب نقش بسزایی در حذف ترکیبات آلی فاضلاب دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده افزودن کاتالیست تأثیر زیادی در حذف ترکیبات آلی دارد و می‌تواند ترکیبات آلی را در حد قابل قبولی از پساب کارخانه نساجی حذف نماید.

۵- قدردانی

به این وسیله از همکاری مسئولان محترم کارخانه نساجی اردبیل برای مساعدت در انجام این پژوهش قدردانی می‌شود.

References

- Anju, S. G., Yesodharan, S. & Yesodharan, E. P. 2012. Zinc oxide mediated sonophotocatalytic degradation of phenol in Water. *Chemical Engineering Journal*, 189-190, 84-93.
- Eskandarloo, H., Badiei, A., Behnajady, M. A. & Ziarani, G. M. 2016. Ultrasonic-assisted degradation of phenazopyridine with a combination of Sm-doped ZnO nanoparticles and inorganic oxidants. *Ultrasonics Sonochemistry*, 28, 169-177.
- Gaya, U. & Abdullah, A. 2008. Heterogeneous photocatalytic degradation of organic contaminants over titanium dioxide: a review of fundamentals, progress and problems, *Journal of Photochemistry and Photobiology, C: Photochemistry Reviews*, 9, 1-12.
- Gopalakrishnan, R. & Muthukumaran. 2013. Nanostructure, optical and photoluminescence properties of $\text{Zn}_{1-X}\text{Ni}_{X}\text{O}$ nanoclusters by co-precipitation method. *Journal of Material Science: Materials in Electronics*, 24, 1069-1080.
- Grčić, I., Vujević, D., Žižek, K. & Kopriyanac, N. 2013. Treatment of organic pollutants in water using TiO_2 powders. *Photocatalysis Versus Sonocatalysis*, 109, 335-354.
- Grieve, K. & Mulvaney, P. 2005. Synthesis and electronic properties of semiconductor nanoparticles quantum dots. *Journal of Current Opinion in Colloid and Interface Science*, 5, 168-172.
- Lee, H. H., Chen, G. & Yue, P. L. 2001. Integration of chemical and biological treatments for textile industry wastewater: a possible zero-discharge system. *Water Science and Technology*, 44, 75-83.
- Mousavi, S. A., Mohammadi, P., Parastar, S. M., Ghaebzadeh, M. & Kamari, F. 2013. Efficiency of fenton oxidation in Rodamine B removal from synthetic solutions. *Journal of Water and Wastewater*, 25(6), 122-129. (In Persian)
- Sankara, R.B., Venkatramana, R. S., Koteeswara, R. N. & Pramoda, K. J. 2013. Synthesis, structural, optical properties and antibacterial activity of co-doped (Ag, Co) ZnO nanoparticles. *Research Journal of Material Sciences*, 1(1), 11-20.
- Seyed Mousavi, M. & Sqeb, K. 2019. The wastewater quality for the combined cycle power plant of Montazer Qaem to be re-used in agriculture. *Anthropogenic Pollution Journal*, 3(1), 54-60.

کروماتوگرام دستگاه GC-MS (شکل ۸)، در نمونه تحت تأثیر امواج التراسونیک در حضور نانوذرات بیسوموت اکسید، ترکیبات شیمیایی n-Decane و n-Dodecane ۹۲/۱۴ درصد و ترکیبات شیمیایی n-Tetradecane و n-Hexadecane بیش از ۹۹ درصد حذف شده‌اند (جدول ۸). سانکارا و همکاران نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند (Sankara et al. 2013).

جدول ۸- درصد حذف ترکیبات موجود در فاضلاب با امواج

التراسونیک در حضور نانوذره اکسید بیسوموت

Table 8. Sonocatalytic removal percentage of chemical compounds in wastewater with Bi_2O_3 nanoparticle

Chemical compounds	Sonocatalytic removal percentage with Bi_2O_3 nanoparticle (%)
n-Decane	92.14%
n-Dodecane	95.13%
n-Tetradecane	more than 99
Hexadecane	more than 99